

**СПОНТАННАЯ ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ
В ГЕТЕРОПЕРЕХОДАХ II ТИПА
НА ОСНОВЕ GaInAsSb/GaSb ($\lambda=2.5$ мкм, $T=300$ К)**

Андаспаева А. А., Баранов А. Н., Гребенщикова Е. А.,
Гусейнов А. А., Именков А. Н., Рогачев А. А.,
Филаретова Г. М., Яковлев Ю. П.

Сообщается об исследовании спонтанной электролюминесценции в гетеропереходах II типа на основе GaInAsSb/GaSb ($\lambda=2.5$ мкм, $T=300$ К).

Исследовались спектры излучения, внешний квантовый выход и постоянная времени спада излучения изотермических структур n -GaSb— n -Ga_{0.75}In_{0.25}As_{0.22}Sb_{0.78}— p -GaAlSbAs с различной толщиной узкозонной области в интервале значений 0.4—5 мкм при температурах 77 и 300 К.

Обнаружено, что при изменении толщины узкозонной области от 5 до 0.4 мкм энергия максимума полосы излучения сдвигается в длинноволновую область на 20—30 мэВ (при 77 и 300 К), постоянная времени спада уменьшается почти на порядок от 10^{-8} до 10^{-9} с, а внешний квантовый выход излучения увеличивается почти в 5 раз.

В результате анализа данных по электролюминесцентным и фотоэлектрическим свойствам делается вывод о том, что излучательная рекомбинация в диодах с толстой узкозонной областью является преимущественно квазимежзонной, а в диодах с тонкой узкозонной областью доминирующую роль играет интерфейсная люминесценция через состояния на n -границе.

Обсуждается модель излучательных переходов через границу раздела гетероперехода II типа.

1. Исследование спонтанной электролюминесценции узкозонных гетероструктур на основе GaInAsSb/GaSb имеет научное и прикладное значение. В этой системе реализуется гетеропереход II типа, и люминесценция таких структур только начинает изучаться. На их основе возможно создание высокоэффективных светодиодов для диапазона длин 1.8—2.5 мкм, перспективного для волоконно-оптических линий связи третьего поколения, а также для целей влагометрии и газового анализа.

В работе [1] нами было доложено о создании высокоэффективных светодиодов на основе GaInAsSb/GaSb, излучающих на длине волны $\lambda=2.2$ мкм при $T=300$ К с внешним квантовым выходом $\eta_e=4\%$. В данной же работе впервые рассматривается спонтанная электролюминесценция из таких гетеропереходов в более длинноволновой области спектра ($\lambda \approx 2.5$ мкм) вблизи границы несмешиваемости твердого раствора. Интерес к спонтанным источникам в этом спектральном диапазоне обусловлен созданием флюоридных светодиодов, в которых уже достигнут сверхнизкий уровень потерь (~ 0.025 дБ/км) на длине волны 2.5 мкм [2].

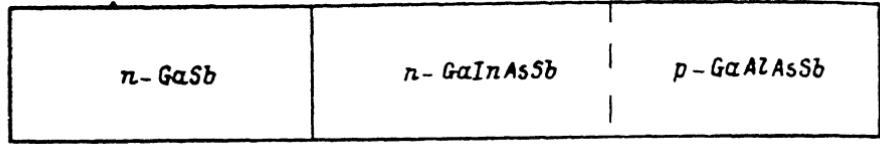
2. Светоизлучающая структура (рис. 1, a) создавалась методом жидкостной эпитаксии на подложке n -GaSb (111)B. Активная область структуры была выполнена из слоя твердого раствора n -Ga_{0.75}In_{0.25}As_{0.22}Sb_{0.78} вблизи границы несмешиваемости, к которому с одной стороны прилегает слой антимонида галлия n -типа ($n \approx 5 \cdot 10^{17}$ см⁻³), а с другой стороны — широкозонный слой p -GaAlSbAs ($E_g=1.2$ эВ, $p=2 \cdot 10^{18}$ см⁻³). Активная область структуры была легирована теллуром до концентрации $(1 \pm 8) \cdot 10^{16}$ см⁻³, толщина варьировалась в интервале 0.4—5 мкм. Из такой структуры были изготовлены меза-светодиоды (диаметром ~ 300 мкм) с сеточным омическим контактом к n -GaSb (Au + 5 % Te).

и точечным (диаметром ~ 40 мкм) омическим контактом к p -GaAlSbAs (Au + 5 % Ge).

Исследовались диоды с различной толщиной активной области (в интервале 0.4—5 мкм). Измерялись спектры и квантовый выход излучения, постоянная времени спада излучения при выключении тока, спектр фотоответа, а также вольтамперные и вольтъемкостные характеристики.

Приемником излучения служил фотодиод, изготовленный нами на основе GaInAsSb [3]. Спектры излучения корректировались с учетом чувствительности фотоприемника и прозрачности измерительной установки.

a



b

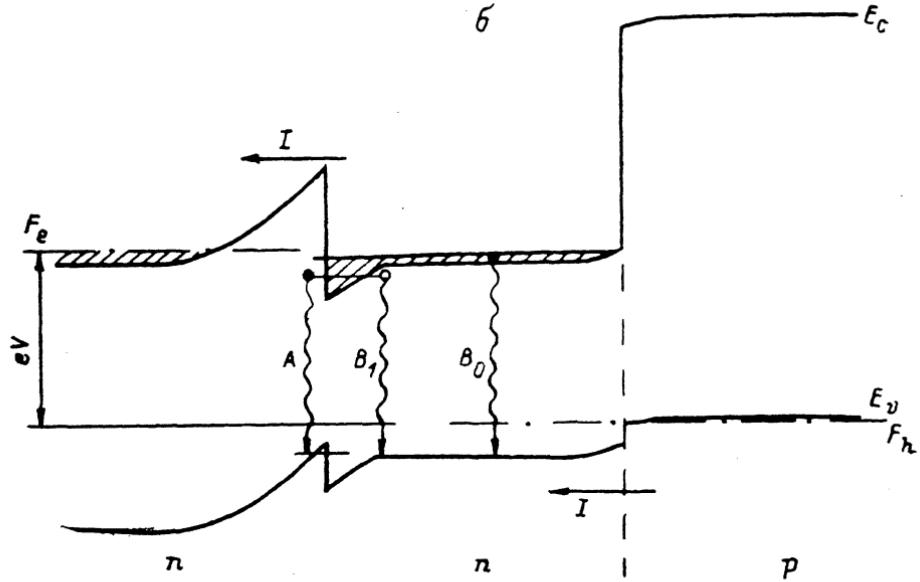


Рис. 1. Схема гетероструктуры (a) и волновая энергетическая диаграмма (б).

3. Результаты спектральных исследований диодов с различной толщиной активной области приведены в таблице.

Спектры электролюминесценции ($I=50$ мА) диодов с различной толщиной активной области и одинаковым составом для 77 и 295 К показаны на рис. 2, а. Рассмотрим спектры электролюминесценции с толстой активной ($d=5$ мкм) и тонкой активной ($d=0.4$ мкм) областями.

Спектры излучения диодов с толстой активной областью имеют одну полосу с энергией максимума $h\nu_{m_1}=0.535$ (295 К) и 0.584 эВ (77 К). Полоса неполяризована в любом направлении распространения света. Характерно, что спектры электролюминесценции диодов с тонкой активной областью смешены в более длинноволновую область за счет генерации излучения другой физической природы $h\nu_{m_2}=0.501-0.512$ эВ (295 К) и 0.561—570 (77 К). Это новое излучение при наблюдении в плоскости $p-n$ -перехода имеет TE-поляризацию в длинноволновой части полосы (вектор E электромагнитного поля излучения параллелен плоскости $p-n$ -перехода). Коэффициент поляризации достигает значения 0.1—

Электролюмисцентные характеристики структур

Тип диода	d , мкм	Концентрация носителей $\times 10^{16}$, см $^{-3}$	η_e , % при T , К		τ , нс при T , К		$h\nu_m$, мэВ при T , К		$\Delta h\nu_m$, мэВ при T , К	
			77	295	77	295	77	295	77	295
170 (a)	0.4	9	6	1	2.5	3	561	501	30	60
169 (a)	1	5	8	0.8	2.5	2.8	570	512	38	64
203	1.8	0.3	3	0.5	4	6	580	530	31	68
167 (a)	3.0	8	2	0.4	6	9	583	534	25	55
208	5.0	9	0.6	0.2	8	12	584	535	30	60

0.2. В направлении, перпендикулярном плоскости $p-n$ -перехода, излучение не поляризовано.

Постоянная времени спада регистрируемых импульсов при выключении тока (которая характеризует среднее время жизни неравновесных носителей заряда) уменьшается с уменьшением толщины активной области от 12 ($d=5$ мкм) до 2 нс ($d=0.4$ мкм) при $T=295$ К и от 8 до 2 нс при 77 К. Отметим, что экстраполяция экспериментальных кривых к $d=0$ дает время жизни неравновесных носителей заряда на $n-n$ -гетерогранице, равное 1 нс (рис. 3).

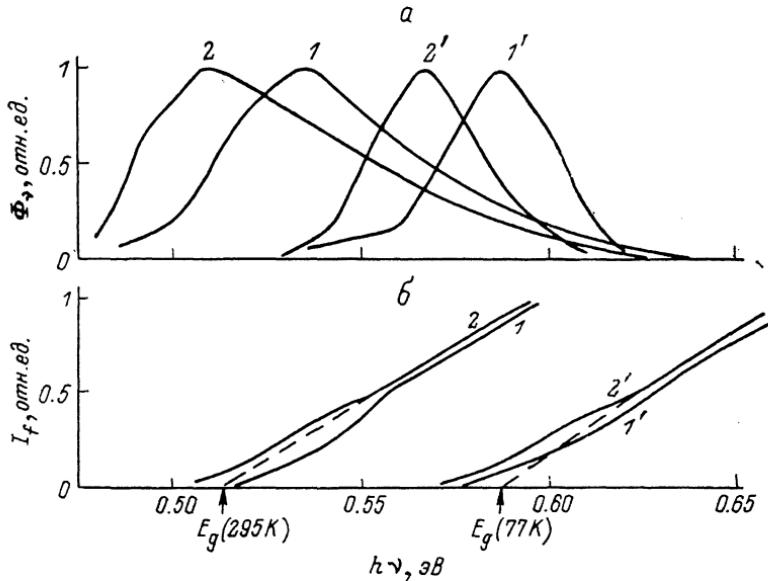


Рис. 2. Спектры излучения (a) и фототока (б) структур с толстой (1, 1') и тонкой (2, 2') активными областями.

T , К: 1, 2 — 295; 1', 2' — 77.

Характерно, что внешний квантовый выход излучения при комнатной температуре возрастает (почти в 5 раз) с уменьшением толщины активной области от 5 до 0.4 мкм. Однако максимальное значение $\eta_e = 1\%$ остается ниже в 2—3 раза, чем в структурах с $\lambda = 2.0$ —2.2 мкм [1]. При 77 К внешний квантовый выход излучения в 20—30 раз больше, чем при комнатной температуре.

Для анализа спектров излучения был изучен длинноволновый край фотоответа при освещении структур со стороны p -GaAlSbAs (рис. 2, б).

В образцах с толстой активной областью формы спектра близки к параболическим, т. е. $I_f \sim (h\nu - h\nu_0)^{0.5}$, где $h\nu_0 = 0.51$ (295 К) и 0.58 эВ (77 К). Такой характер спектра фотоответа соответствует краю поглощения в прямозонном слабо легированном полупроводнике, и $h\nu_0$ может быть отождествлена с шириной запрещенной зоны E_g активной области.

В то же время спектр фотоответа структур с тонкой активной областью смешен в длинноволновую сторону за счет появления фоточувствительности при $h\nu \leq E_g$.

Появление такой дополнительной фоточувствительности при $h\nu \leq E_g$, вызвано, вероятно, электронными переходами вблизи границы раздела $n\text{-GaSb}$ — $n\text{-GaInAsSb}$.

4. Проанализируем полученные экспериментальные результаты. Узкозонный слой GaInAsSb образует с GaSb гетеропереход II типа [4], в котором зонная энергетическая диаграмма узкозонного полупроводника смешена относительно энергетической диаграммы GaSb, так что разрыв в зоне проводимости и валентной зоне имеет один и тот же знак. В такой структуре при инжекции дырок в n -область возможны три типа излучательных переходов (рис. 1, б): квазимежзонная рекомбинация B_0 и два типа интерфейсной рекомбинации A и B_1 . Такие излучательные переходы недавно удалось наблюдать на границе $p\text{-GaSb}$ — $p\text{-GaInAsSb}$ [6].

Анализ всех данных по электролюминесцентным и фотоэлектрическим свойствам $n\text{-GaSb}$ — $n\text{-GaInAsSb}$ — $p\text{-GaAlSbAs}$ структур позволил прийти к выводу

о том, что излучательная рекомбинация в диодах с толстой активной областью ($d \geq 3$ мкм) является преимущественно квазимежзонной, а в диоде с тонкой активной областью ($d=0.4$ мкм) доминирующую роль играют излучательные переходы через состояния на n — n -гетерогранице (интерфейсная рекомбинация). Этот вывод был сделан на основе следующих фактов.

В структурах с толстой активной областью ($d \geq 3$ мкм) доминирует полоса, энер-

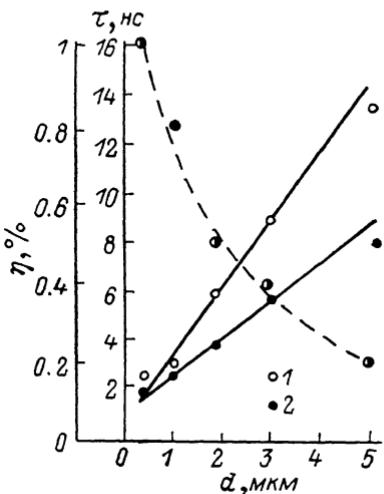


Рис. 3. Зависимость внешнего квантового выхода излучения (штриховая кривая) и постоянной времени спада интенсивности излучения (сплошные

от толщины узкозонного слоя).

$T, \text{K}: 1 - 295, 2 - 77.$

гия максимума которой близка к ширине запрещенной зоны E_g активной области ($h\nu_m$ оказывается больше E_g , определенной из экспериментальной зависимости спектра фототока, на величину $\sim kT/2$). Среднее время жизни неравновесных носителей заряда в структурах с тонкой активной областью, определенное из времени спада излучения при выключении тока, составляет ~ 12 нс ($T=295$ К). Это время жизни неравновесных дырок близко к значению 10^{-8} с, полученному для GaSb [6]. Форма полосы излучения соответствует межзонным переходам при параболической форме краев зон при наличии «хвостов», и такую полосу можно отождествить с квазимежзонной полосой рекомбинации типа B_0 (рис. 1, б).

С уменьшением толщины активной области в спектре излучения начинает увеличиваться доля длинноволнового излучения, и при $d \leq 1$ мкм энергия максимума излучения становится меньше E_g активной области. При этом спектр фотоответа смешается в длинноволновую область (рис. 2, а). Наиболее существенные изменения происходят со временем жизни неосновных носителей заряда: оно изменяется почти на порядок при изменении толщины активной области и приближении p — n -перехода к n — n -гетерогранице. При этом излучение становится слабо поляризованным. Все это указывает на существенное изменение механизма излучательной рекомбинации и доминирующую роль интерфейсной люминесценции в структурах с тонкой активной областью. Длинноволновую полосу излучения можно отождествить с полосой типа B_1 ; переходы между состояниями для электронов в самосогласованной квантовой яме и состояниями для тяжелых дырок в подложке, вероятно, дают значительно меньший вклад

в излучение, поскольку степень TE -поляризации интерфейсной люминесценции невелика и составляет 0.1—0.2.

Увеличение внешнего квантового выхода излучения с уменьшением толщины активной области показывает, что внутренний квантовый выход излучения через квантовые состояния на гетерогранице больше, чем при межзонной рекомбинации в толще полупроводника.

Список литературы

- [1] Андаспаева А. А., Баранов А. Н., Гусейнов А. А., Именков А. Н., Литвак А. М., Филаретова Г. М., Яковлев Ю. П. // Письма ЖТФ. 1988. Т. 14. В. 9. С. 845—849.
- [2] Ewing K. J. et al. // Proc. V Halide Glass symp. Shizuoka, 1988. Р. 139—145.
- [3] Андреев И. А., Афраимов М. А., Баранов А. Н., Данильченко В. Г., Мирсагатов М. А., Михайлова М. П., Яковлев Ю. П. // Письма ЖТФ. 1986. Т. 12. В. 21. С. 1311—1315.
- [4] Nakao M., Yoshida S., Gonda S. // Sol. St. Comm. 1984. V. 49. N 7. P. 663—666.
- [5] Баранов А. Н., Гусейнов А. Н., Рогачев А. А., Титков А. Н., Чебан В. Н., Яковлев Ю. П. // Письма ЖЭТФ. 1988. Т. 48. В. 6. С. 342—344.
- [6] Агаев В. В., Титков А. Н., Чайкина Е. И. // ФТП. 1984. Т. 18. В. 4. С. 750—752.

Физико-технический институт
им. А. Ф. Иоффе АН СССР
Ленинград

Получена 9.03.1989
Принята к печати 20.03.1989